电子束蒸发系统

Electron Beam Evaporation System

EB900、EB700、EB500、DZS500



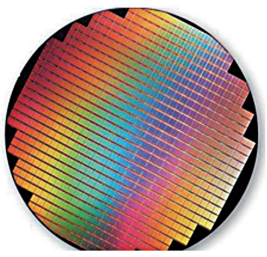
性能指标

- 真空系统极限真空度：≤ 2.6×10^{-5} Pa，系统从大气开始抽气，20 分钟可达到 2.6×10^{-4} Pa
- 蒸发材料：Au、Ag、Al、Cu、Si 等
- 蒸发速率范围：0.1—30 Å /sec
- 膜厚均匀性：＜ ±5%；膜厚测量：石英晶振膜厚仪，水冷探头

主要应用

用于金属、半导体等材料的薄膜制备

代表性应用成果


晶圆


触摸屏

主要用户单位	中科芯集成电路股份有限公司、天津大学、南京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、中国电子科技集团公司第二十六研究所等
研制单位	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
联系方式	方老师　024-23826855，23826899，23826827，23826820